

PR-PVD-DC 控磁控溅射仪

PR-PVD-DC 是一款小型台式溅射功率可控磁控溅射仪，仪器虽小功能齐全，配备有电压 电流反馈,样品台旋转，样品高度调节，及电动挡板功能。通过定时调节预溅射功率及薄膜沉积功率，可对大部分金属进行均匀物理沉积，真空腔室为透明高硼玻璃减少样品污染，样品台可旋转以获 得更均匀的薄膜，可制备各种金属薄膜。



控制方式	7 寸人机界面 手动/自动模式切换控制
溅射电源	直流溅射电源
镀膜功能	0-999 秒 5 段可变换功率及挡板位和样品速度程序
功率	≤1000W
输出电压电流	电压≤1000V 电流≤1A
真空	机械泵 ≤5Pa (5 分钟) 分子泵≤5*10 ⁻³ Pa
溅射真空	≤30Pa
挡板类型	电控
真空腔室	石英+不锈钢腔体 φ 160mm x 170mm
样品台	可旋转 φ 62 (可安装 φ 50 基底)
样品台转速	8 转/分钟
样品溅射源调节距离	40-105mm
真空测量	皮拉尼真空计 (已安装 测量范围 10E5Pa 1E-1Pa)
预留真空接口	KF25 抽气口 KF16 放气口 6mm 卡套进气口